

Seminario sobre el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales

Ginebra, 4 de noviembre de 2011

PROGRAMA PROVISIONAL

preparado por la Secretaría

- 9.00 – 9.30 Inscripción
- 9.30 – 9.45 Discurso de bienvenida pronunciado por:

Sr. Yves Closet, Jefe de la Sección de Información y Promoción, Registro Internacional de Dibujos y Modelos, Sector de Marcas y Dibujos y Modelos, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra
- 9.45 – 10.15 **Panorama General del Sistema de La Haya**

Objetivos y características del Sistema de La Haya
El Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya y acontecimientos recientes

Oradora: Sra. Päivi Lähdesmäki, Jefa de la Sección Jurídica, Registro Internacional de Dibujos y Modelos, Sector de Marcas y Dibujos y Modelos, OMPI
- 10.15 – 11.00 **Presentación de una Solicitud Internacional**

Derecho a presentar una solicitud internacional
Idiomas
Representación ante la Oficina Internacional de la OMPI

Oradora: Sra. Marina Foschi, Jurista de la Sección Jurídica, Registro Internacional de Dibujos y Modelos, OMPI
- 11.00 – 11.15 Pausa para el café
- 11.15 – 12.30 **La Solicitud Internacional y el Proceso de Examen**

Contenido de una solicitud internacional
Reproducciones de dibujos y modelos industriales
Examen de una solicitud por la Oficina Internacional de la OMPI
Presentación electrónica de solicitudes internacionales (E-filing)
Irregularidades

Orador: Sr. Patrick Cartant, Jefe de la Sección de Examen, Registro Internacional de Dibujos y Modelos, Sector de Marcas y Dibujos y Modelos, OMPI
- 12.30 – 14.00 Almuerzo
- 14.00 – 14.45 **Registro Internacional**

Publicación y aplazamiento de la publicación
Posibilidad de denegación
Efectos del registro internacional y duración de la protección

Orador: Sr. Hiroshi Okutomi, Jurista de la Sección Jurídica, Registro Internacional de Dibujos y Modelos, Sector de Marcas y Dibujos y Modelos, OMPI

